

Kenix

ALD装置

原子層堆積装置



Kenix

- トリメチルアルミニウム（TMA）と純水を原料として、アルミナ（ AlO_3 ）の絶縁膜を成膜出来ます。
- バルブ開閉操作はタッチパネルより自動で操作することができます。
- ヒーター加熱温度：MAX700°C対応しています。

ケニックス株式会社

〒670-0935 兵庫県姫路市北条口2-15-501
TEL.079-283-3150 /FAX 079-280-3002
kenix@leto.eonet.ne.jp www.kenix.jp/

